## 科学研究費助成事業 研究成果報告書



交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,900,000円

研究成果の概要(和文):SiCと高い整合性を持ち、高融点かつ導電性のSiCエピタキシャル基板として有望な SiC-ホウ化物系共晶体の探索を目的とした。本研究ではSiC-CrB2やSiC-VB2に焦点を当て、アーク溶解法により 溶融凝固し、仕込み組成が微細組織や結晶方位に及ぼす影響を調べた。SiC-CrB2ではSiC組成が22.5 mol%で微細 なSiCがCrB2母相に分散した共晶組織を形成した。一方、SiC-VB2の共晶組成は45 mol%(SiC)であり、SiC(111) //VB2(1-210)およびSiC[0-11]//VB2[0001]の結晶方位関係をもつSiCとVB2の双方が単結晶性の一方向凝固組織を 形成した。

研究成果の概要(英文): This study aimed to explore substrates, having high-temperature stability and electrical conductivity, for SiC epitaxial growth by developing melt solidification of eutectics comprising SiC and transition metal diborides. We melted and solidified composites of SiC-CrB2 and SiC-VB2 by an arc-melting method and investigated effects of nominal compositions on the resultant microstructure and crystal orientation relationships in the eutectic composites. In SiC-CrB2, the eutectic composition was 22.5 mol% of SiC, in which the minute eutectic structure consisting of fine SiC grains several hundreds of nanometers dispersed in CrB2 matrix formed. The SiC-VB2 eutectic composite at the eutectic composition of 45 mol% SiC exhibited single-crystalline-like unidirectionally solidified microstructure with the crystal orientation relationship of SiC(111) //VB2(1-210) and SiC[0-11]//VB2[0001].

研究分野: 複合材料

キーワード: 共晶 炭化ケイ素 ホウ化物 高温 溶融凝固 一方向凝固

1. 研究開始当初の背景

次世代パワー半導体における高品質な SiC のエピタキシャル膜の作製プロセスは昇華 法や化学気相析出法などの気相法が主流で あり、このための基板材料には、SiC との格 子整合性が高く、1400 K 以上の高温で化学的 安定性を持つことが必要とされる。これまで、 基板には単結晶 Si 上にバッファー層を形成 したもの (ヘテロエピタキシャル成長)、も しくは、単結晶 SiC (ホモエピタキシャル成 長)が用いられてきた。前者は、SiC との格 子整合が完全に一致していなく、欠陥濃度を 制御することが難しい。一方、後者では、高 品質な SiC が得られるが、基板となる SiC 単 結晶基板を大型化することが難しい。従来の Si 半導体や太陽電池の分野では、溶融凝固に よる Si インゴット育成技術が確立されてき たが、同様に、SiC エピタキシャル成長に有 効で SiC 単結晶ライクな基板を溶融凝固によ り育成できれば、工程の短縮や大型化、低コ スト化を期待できる。

我々は高融点の遷移金属基炭窒化物-ホウ 化物間の共晶コンポジットをアーク溶解に より溶融凝固し、母相と分散相がいずれも単 結晶で構成される複合体を作製してきた。こ の中で、立方晶 NaCl型の TiCN と六方晶 AlB<sub>2</sub> 型の TiB<sub>2</sub>の構造類似性により、結晶方位が単 一方向に揃った特異な組織が形成されるこ とを明らかにしてきた[1-3]。このような Ti 基非酸化物同士の共晶体では、特定の結晶面 において単結晶と同一の Ti 原子配列が現れ る。これらの遷移金属基非酸化物は、高融点

(2500 K 以上)であり、さらには導電性を持っため、SiC と格子整合する共晶体による基板を溶融凝固により容易に製作できれば、既存の半導体や絶縁体の基板とは異なる新しいデバイス設計を可能にする。

SiC は高温で固体から直接気体に昇華する ため、SiC 単体では溶融しない。SiC は ZrB2 や TiB2、B4C など、いくつかのホウ化物と共 晶関係にあり、複合化することで溶融でき、 凝固時に単結晶ライクな組織を形成するこ とが報告されている。これらの共晶温度は 2500 K 以上の高温であるため、溶融状態の維 持・制御が極めて難しい。本研究では、SiC との共晶温度が比較的低い、または、共晶点 に関する既往報告のないホウ化物-SiC 系共 晶体に着目し、溶融凝固により SiC との格子 整合性に優れ、高温安定性と導電性を持つ基 板材料の探索を行った。

2. 研究の目的

SiCと六方晶 AlB<sub>2</sub>型の結晶構造を持つ遷移 金属基ホウ化物の溶融凝固による擬二元系 相安定性、共晶組織、およびそれらの結晶方 位関係を明らかにすることを目的とする。本 研究では、SiC との共晶温度が 2303 Kと報 告されている SiC-CrB<sub>2</sub>と、これまでに共晶組 成や温度の報告のないSiC-VB<sub>2</sub>をアーク溶解 し、組成が溶融凝固後の構成相や微細組織お よび結晶方位を調べた。 3. 研究の方法

SiC 粉末 (2–5 µm、高純度化学研究所)、CrB<sub>2</sub> 粉末 (2–30 µm、日本新金属)および VB<sub>2</sub>粉 末 (2–5 µm、日本新金属)を出発原料とした。 SiC–CrB<sub>2</sub>では SiC 組成を 10–90mol% (CrB<sub>2</sub> 組成:90–10mol%)、SiC–VB<sub>2</sub>では SiC 組成を 10–70mol% (VB<sub>2</sub> 組成:90–30mol%)で秤量 し、少量のエタノールとともに簡式遊星ボー ルで 10.8 ks 間混合した。混合粉末を乾燥処理 した後、直径 10 mm のペレット状に圧粉成型 した後、直径 10 mm のペレット状に圧粉成型 した。これらの圧粉成形体をアーク溶解炉 (MRHS-500 (S-1)、ダイヘン)によりアル ゴン雰囲気中 (50 kPa)で溶融凝固した。こ のとき、10–20 V、100–200 A とし、試料の表 面および裏面を 1 回ずつ溶融し、それぞれ溶 融時間は約 360 s とした。

得られたボタン状試料の両面を機械研磨した後、X線回折(XRD; CuKα, Ultima IV, Rigaku)により構成相を同定した。微細組織 観察には走査型電子顕微鏡(SEM; S3100H お よび S-4800、日立ハイテクフィールディン グ)および透過型電子顕微鏡(TEM; 200 kV, EM-002B, TOPCON)を用いた。また、電解 放出型走査型電子顕微鏡(FESEM、JSM-7100F、 日本電子)を用いた電子線後方散乱法 (EBSD)により共晶組織の結晶方位解析を 行った。

4. 研究成果

(1) SiC-CrB<sub>2</sub>の溶融凝固

SiC 組成 10–80mol%の SiC–CrB<sub>2</sub> 圧粉成形体 はアーク溶解法により溶融でき、緻密なバル ク試料が得られた。いずれの組成でも SiC–CrB<sub>2</sub>コンポジットの構成相は SiC および CrB<sub>2</sub>であったが、SiC 組成が 10–60mol%での SiC は立方晶( $\beta$ 型)であり、一方、SiC 組成 が 70mol%以上での SiC は六方晶( $\alpha$ 型)であ った。一般に、 $\beta$ -SiC は低温相であり、 2273–2373 K 以上の高温で $\alpha$ -SiC に相変態す ることが知られている。共晶組成近傍では融 液が比較的低温で凝固し、 $\beta$ -SiC が初晶(ま たは、共晶)として析出する。一方、70 mol% 以上では融液の温度が高く、SiC 初晶の析出 も高温で起こるため、 $\alpha$ -SiC が生成したと考 えられる。

SiC-CrB<sub>2</sub> 複合体の微細組織を図1に示す。 視野中の黒色の相が SiC であり、灰色の相が CrB2である。SiC 組成が 10 mol%では、数十 um サイズの CrB2の初晶の間に微細な SiC-CrB<sub>2</sub> 共晶組織が形成された(図 1(a))。 SiC 組成が増加すると共晶組織の面積分率が 増加し、SiC 組成 20 mol%では微細な共晶組 織が試料全面に形成された(図1(b)および(c))。 この共晶組織は微細な迷路状であり、幅 100-200 nm、長さ 2-10 µm の SiC が CrB2マ トリックス中に均一に分散した形態であっ た。SiC 組成が 22.5 mol%以上になると SiC の 増加にともない、三角形状の SiC 初晶が析出 し、SiC-CrB2共晶組織の面積分率は減少した (図 1(d); SiC 組成 60 mol%)。共晶組織にお ける SiC および CrB, 各相の面積分率から



図 1 アーク溶解により作製した SiC-CB<sub>2</sub>の SEM 像。(a) 10SiC-90CB<sub>2</sub>、(b,c) 20SiC-80CrB<sub>2</sub>、(d) 60SiC-40CrB<sub>2</sub>。

SiC-CrB<sub>2</sub> コンポジットの共晶組成は 22.2SiC-77.8CrB<sub>2</sub> (mol%)であり、これは Ordanyan らが報告した状態図 [4]のものとほ ぼ一致した。SiC-CrB<sub>2</sub>共晶組織中の SiC は微 細であり、EBSD の分析サイズの制限から結 晶方位を同定することはできなかった。ただ し、図 1(c)は、凝固方向に対して水平な面で あり、このような共晶組織において CrB<sub>2</sub>はお およそ(0001)に配向することが分かった。

## (2) SiC-VB<sub>2</sub>の溶融凝固

SiC 組成が 10–60mol%の SiC–VB<sub>2</sub> ではアー ク溶解により溶融凝固し、緻密な複合体試料 が作製できたが、70 mol%以上ではアーク溶 解中に試料の蒸発が著しく、緻密な試料は得 られなかった。XRD 図形から、これらの緻密 な SiC–VB<sub>2</sub> バルク試料 (SiC 組成: 10–60 mol%) は VSi<sub>2</sub> や V<sub>2</sub>B<sub>3</sub> Si などの微量の不純 物相は含むものの、 $\alpha$ -SiC と VB<sub>2</sub> が主相であ



図 2 アーク溶解により作製した SiC-VB2 の SEM 像。(a) 20SiC-80VB<sub>2</sub>, (b, c) 45SiC--55VB<sub>2</sub>, および(d) 60SiC-40VB<sub>2</sub>.

り、溶融凝固過程を経た後も SiC–VB<sub>2</sub> 複合体 であることを確認した。VB<sub>2</sub>の融点は 3200 K であり、CrB<sub>2</sub> (2303 K) と比べて高い。この ため、液相線も高温となり、いずれの組成に おいても SiC は高温相の  $\alpha$  型であった。なお、 SiC 組成が 47.5 mol%で作製した  $\alpha$ -SiC–VB<sub>2</sub> 複合体の XRD 図形からは不純物相のピーク は認められなかった。

SiC-VB2複合体の微細組織を図2に示す。 視野中の黒色の相がSiCであり、灰色の相は VB2である。SiC組成が20mol%では、丸み のある数十 µm サイズのVB2初晶と微細な SiC-VB2 共晶組織が形成した図2(a)。この SiC-VB2 共晶組織の領域(面積分率)は、SiC 組成が増加するとともに広がり、SiC組成が 45mol%で試料の全域に微細な共晶組織が形 成された(図2(b))。図2(c)はSiC-VB2の微 細組織の拡大像であり、黒色のSiCと灰色の VB2は1µm以下の微細で異方性をもった迷 路状組織を形成した。一方、SiC組成が比較



図345SiC-55VB2のEBSDによる相分布像(a)、 逆極点図(b)および極点図(c)。(d)および(c)はSiC (111)および(110)とVB2(1-210)および(0001)に おける面内の原子配列モデル。

的高い  $40SiC-60VB_2$  では粗大な棒状の SiC 初晶と共晶組織が形成した(図 2(d))。これ までに SiC-VB<sub>2</sub> 擬二元系相図の報告はない が、アーク溶解した SiC-VB<sub>2</sub>試料の構成相と 微細組織から、SiC-VB<sub>2</sub>は擬二元共晶系と考 えられる。また、共晶組織中の SiC と VB<sub>2</sub> の面積分率から、共晶組成は SiC: VB<sub>2</sub> = 45:55 (mol%)であり、SiC-CrB<sub>2</sub> 共晶よりも SiC リッチ組成の共晶体であった。

SiC-VB2 組織における相分布図 (a)、逆極 点図 (b)および β-SiC と VB2の極点図(c)を図 3に示す。 $\beta$ -SiCとVB<sub>2</sub>の各相のグレインは、 同一方位に配列された単結晶で構成され、そ れぞれ SiC (111)と VB2 (1-210)面内の一方向 に延伸した組織であった。また、二相の結晶 方位関係は SiC(111)//VB<sub>2</sub>(1-210)および SiC[0-11]//VB<sub>2</sub>[0001]であった。この結晶方位 関係における SiC (111)および VB<sub>2</sub> (1-210)の 原子配列を図 3(d)に示す。SiC(11-2)の3倍の 面間隔(5.34Å)とVB2(1-100)の2倍の面間隔 (5.19 Å)、SiC(0-11)および VB<sub>2</sub>(0001)の整合 性が高いことがわかる。図3(e)には、SiC(110) および VB2 (0001)面内の原子配列を示す。こ れらは、図 3 (a)および(b)において、SiC の延 伸方向と平行な断面に対応する。SiC(0-11)と VB<sub>2</sub>(0001)においても面内の原子配列や、 SiC(1-11)と VB2(1-100)の面間隔に整合性がみ られる。このように、SiC (111)//VB2 (1-210) の結晶方位関係での高い格子整合性は、融液 からの凝固(相分離)過程で形成する特異な 微細組織と相関があるものと考えられる。

<引用文献>

[1] E.J.Cheng, H. Katsui, R. Tu, T. Goto, J. Euro. Ceram, Soc. 34 (2014) 2089–2094.

[2] E.J.Cheng, H. Katsui, R. Tu, T. Goto, J. Am. Ceram, Soc. 97 (2014) 2423–2426.

[3] E.J.Cheng, H. Katsui, T. Goto, Key. Eng. Mater. 616 (2014) 43–46.

[4] S.S. Ordan'yan, A.I. Dmitriev, I.M. Kapitonova, Neorganicheskie Mater. 21 (1991) 157–159.

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計 2 件)

- E.J. Cheng, <u>H. Katsui</u>, T. Goto、 Microstructure of ZrB<sub>2</sub>–ZrN directionally solidified eutectic composite by arc-melting、 Journal of Asian Ceramic Societies、査読有、 Vol. 6、No.1、2018、pp. 102–107、 https://doi.org/10.1080/21870764.2018.1446 467
- ② E.J. Cheng, <u>H. Katsui</u>, T. Goto、 ZrB<sub>2</sub>–ZrC<sub>x</sub>N<sub>1-x</sub> Eutectic Composites Produced by Melt Solidification、Journal of the American Ceramic Society、查読有、Vol. 99、No.2、2016、pp. 667–673、 https://doi.org/10.1111/jace.13984

〔学会発表〕(計 8 件)

- 後藤孝、<u>日井宏和</u>、森田貴信、「溶融凝固 による共晶セラミックスの作製」日本セ ラミックス協会第30回秋季シンポジ ウム、神戸市、2017年9月19-21日
- 2 森田貴信、<u>日井宏和</u>、後藤孝、「レーザー 溶融による SiC 系共晶体の微細組織」日 本セラミックス協会 2017 年年会、東京、 2017 年 3 月 17-19 日
- ③ 森田貴信、<u>日井宏和</u>、後藤孝、「レーザー 溶融による炭化ケイ素と遷移金属ホウ化 共晶体の一方向凝固」第55回セラミック ス基礎科学討論会、岡山市、2017年1月 12-13日
- ④ <u>日井宏和</u>、森田貴信、後藤孝、「レーザー 溶融による炭化ケイ素と遷移金属ホウ化 共晶体の一方向凝固」第11回日本フラ ックス成長研究発表会、仙台市、2016年 12月9日
- ⑤ 森田貴信、<u>日井宏和</u>、後藤孝、「溶融凝固 による SiC-ホウ化物系共晶コンポジッ トの微細組織」平成 28 年度 日本セラミ ックス協会東北北海道支部研究発表会、 札幌市、2016 年 10 月 27-28 日
- ⑥ Kishin MORITA, <u>Hirokazu KATSUI</u>, Takashi GOTO、"Eutectic Composite of SiC and Boride Ceramics by Arc and Laser Melting"、The 1st International Symposium on Creation of Life Innovation Materials for Interdisciplinary and International Researcher Development (iLIM-1)、大阪市、 2016 年 10 月 17 日
- ⑦ <u>日井宏和、森田貴信、後藤孝、「レーザー</u> 溶融凝固による SiC-CrB2 コンポジット の微細組織」日本セラミックス協会第 29 回秋季シンポジウム、東広島市、2016 年 9月7日
- ⑧ <u>日井宏和</u>、後藤孝、「自己組織化によ り 特異な微細組織をもつ高温機能性セラミ ックスの合成」学際・国際的高度人材育 成ライフイノベーションマテリアル創製 共同研究プロジェクト平成 28 年度キッ クオフ公開討論会、名古屋市、2016 年 7 月 8 日
- 6. 研究組織
- (1) 研究代表者
  且井 宏和(KATSUI, Hirokazu)
  東北大学・金属材料研究所・特任准教授
  研究者番号: 70610202
  (2) 研究協力者
  後藤 孝(GOTO, Takashi)

東北大学・金属材料研究所・教授 研究者番号:60125549